

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于ASML-1400光刻机进展暨签订《合作框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)自立项开发 193nm ArF 干法光刻胶的研发及产业化项目以来,根据项目进度,计划安排购买了 ASML-1400 光刻机等核心设备。后受中美贸易摩擦升级、美国针对我国半导体行业的出口管制措施加强及 2020 年初以来一直肆虐的疫情影响,公司进口光刻机的程序更加复杂。公司与光刻机供应商、合作方沟通协调设备运输与安装细节,涉及场地条件、物流运输条件等等,没能在规定时间内完成,但与合作方的具体合作细节已签署了《合作框架协议》。

二、协议的主要内容

甲方: 北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司

乙方: 上海新阳半导体材料股份有限公司

合作内容:

1、甲乙双方将合作在甲方指定工厂搭建光刻胶验证平台,该平台由 ArF 光刻机(乙方负责提供)和涂胶显影机(甲方负责提供)组成,用于先进光刻胶验证。

2、甲乙双方将在 ArF(193nm)干法光刻胶产业化领域采取多样化的模式,开展广泛、深入的合作,包括但不限于:项目合作、团队合作等。

合作期限: 本协议合作期限自 2020 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日

合作方式：

1、甲乙双方建立紧密、高效的信息沟通渠道，管理层之间将定期或不定期会晤和沟通各项进展事宜。

2、甲乙双方同意互邀参与集成电路领域的技术科研开发、建设和技改等工作。

3、本协议为合作框架协议，双方的具体合作内容以及在合作中具体的责任、权利和义务，可以另行签订补充协议。

4、本协议期满时，双方应优先考虑与对方续约合作。

协议生效：本协议自签字起生效。

三、其他相关说明

未来公司将采购的用于 193nm ArF 干法光刻胶研发的 ASML-1400 光刻机放置于合作方指定的地点，双方正在沟通协商光刻机入厂的底座安装及制作事宜，待底座安装完成后，光刻机即可进入合作方进行调试使用。近期新冠疫情在国内有加重反复的趋势，运输物流可能再次受其影响，预计光刻机进入合作方现场的时间是 2021 年 3 月底前。

特此公告。

四、备查文件

1. 合作框架协议。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日